

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成18年7月27日(2006.7.27)

【公開番号】特開2003-257305(P2003-257305A)

【公開日】平成15年9月12日(2003.9.12)

【出願番号】特願2002-54168(P2002-54168)

【国際特許分類】

H 01 J 9/02 (2006.01)

【F I】

H 01 J 9/02 E

【手続補正書】

【提出日】平成18年6月14日(2006.6.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極と該電極間を接続する高分子膜とからなるユニットが複数設けられた基板を用意する工程と、

前記複数のユニットのうち、2以上のユニットの各々を構成する一対の電極間に電位差を与え始めてから、該電位差が与えられている状態のユニットの数よりも少ない数のユニットの各々を構成する高分子膜に順次光又は粒子ビームを照射し、前記電位差が与えられている状態のユニットの各々を構成する高分子膜を低抵抗化させて間隙を形成する工程と、
、
を少なくとも含むことを特徴とする電子源の製造方法。

【請求項2】 前記光は、レーザー光、或いはキセノン光源又はハロゲン光源から放出された光であること特徴とする請求項1に記載の電子源の製造方法。

【請求項3】 前記粒子ビームは、電子ビーム又はイオンビームであることを特徴とする請求項1に記載の電子源の製造方法。

【請求項4】 前記高分子膜は、芳香族ポリイミド、ポリフェニレンオキサジアゾール又はポリフェニレンビニレンのいずれかからなることを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の電子源の製造方法。

【請求項5】 電子源と、該電子源から放出された電子の照射により発光する発光部材とを少なくとも有する画像形成装置の製造方法であって、前記電子源が請求項1乃至4のいずれかに記載の方法にて製造されることを特徴とする画像形成装置の製造方法。